



En cumplimiento a las Bases del Concurso de Diseño Arquitectónico del Pabellón de México en la Exposición Universal Shanghai 2010, el Jurado Calificador después de revisar 156 trabajos recibidos y deliberar durante los días 18, 19 y 20 de marzo del presente, emitió su fallo inapelable con los siguientes ganadores:

	CLAVE DE REGISTRO	ARQUITECTOS
PRIMER LUGAR:	1353893676	Mónica Orozco Moritz Melchert Juan Carlos Vidal Israel Álvarez Mariana Tello Edgar Ramírez
SEGUNDO LUGAR:	1556943129	Salvador Macías Corona Alejandro Guerrero Gutiérrez Margarita Peredo Arenas Iván Orozco Plazota Christian Delgado Ruiz Alejandro Arias Bañuelos
TERCER LUGAR	1473910191	Juan Carlos Seijo Encalada Xavier Abreu Sacramento Alejandra Abreu Sacramento Marcelo Rancel Valenzuela Laura Treviño Zendejas Jonathan Franklin Oynick

GERARDO ESTRADA R.
PRESIDENTE DEL JURADO CALIFICADOR
CONCURSO NACIONAL DEL PABELLÓN DE MÉXICO EN LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL
SHANGHAI 2010.